

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СПЕКТР ЛОКАЛИЗОВАННЫХ СОСТОЯНИЙ АМОРФНЫХ СЛОЕВ Si_xN_x

Э.П. Домашевская, Е.Н. Десятикова,
Г.Л. Курышев, Ю.М. Попов,
В.Н. Селезнев, А.П. Соловьев,
В.А. Терехов, Г.Г. Эльдаров

Слои азотированного аморфного кремния ($\text{a-Si}_x\text{N}_x$) привлекают пристальное внимание исследователей в связи с перспективой использования их в твердотельных приборах [1]. Однако энергетический спектр и микроскопическая природа локализованных состояний (ЛС) в щели подвижности $\text{a-Si}_x\text{N}_x$ в настоящее время не изучены. В данной работе сообщается о результатах исследований энергетического спектра электронных состояний пленок $\text{a-Si}_x\text{N}_x$ методом ультрамягкой рентгеновской спектроскопии (УМРС).

На спектрометре-монохроматоре РСМ-500 регистрировались $\text{SiL}_{2,3}$ -спектры эмиссии, возникающие при переходе электронов из валентной зоны (ВЗ) и заполненных ЛС на вакансию во внутреннем 2р-уровне кремния. Ваканции создавались электронным пучком с энергией электронов 3 кэВ. При этом глубина анализируемой области составляла 60 нм.

На рис. 1 приведены рентгеновские спектры эмиссии пленок $\text{a-Si}_x\text{N}_x$ переменного состава, полученных методом плазмохимического осаждения из газовой смеси $\text{SiH}_4 + \text{NH}_3$ при температуре 280 °С. Область энергий на спектре 80.5–99.6 эВ отражает распределение плотности состояний в ВЗ. За краем зоны отчетливо наблюдается спектр ЛС, который снимался с чувствительностью, увеличенной в 10 раз. Как и следовало ожидать, при соотношении реагентов $R = [\text{NH}_3]/[\text{SiH}_4] = 0$ спектр идентичен известному спектру аморфного кремния [2]. С ростом R увеличивается ширина щели подвижности от ~ 1.7 эВ при $R = 0$ до 6 эВ при $R = 4$. При относительно большом содержании азота (кривые 2 и 3) в спектре ВЗ при энергиях 81.5, 90.6 и 96.6 эВ проявляются особенности А, В и С, характерные для пленок аморфного нитрида кремния. По виду спектра ВЗ можно заключить, что при $R = 4$ состав пленок близок к стехиометрическому $\text{a-Si}_3\text{N}_4$ [3].

Особый интерес представляет спектр ЛС. Видно, что пленки Si_xN_x , близкие к стехиометрическому составу $\text{a-Si}_3\text{N}_4$, характеризуются непрерывной плотностью состояний по всей щели подвижности. На их спектре можно выделить, по крайней мере, три характерных максимума „а”, „в”, „с” при энергиях 100.8, 102.1 и 103.2 эВ соответственно. В наших экспериментах удалось проследить зависимость интенсивности максимума „с” от содержания азота в пленке. С изменением от 2 до 4 интенсивность максимума „с” быстро возрастает (более, чем в 4 раза), в то время как особенности основной полосы А и С, отражающие плотности гибрид-

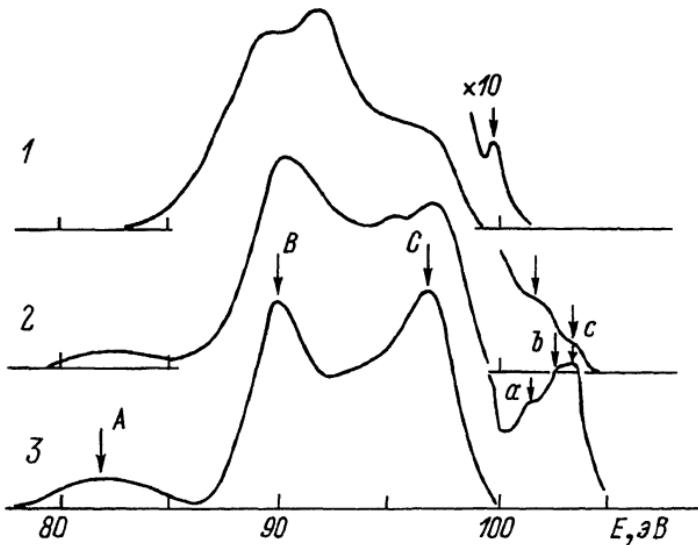


Рис. 1. Рентгеновские спектры эмиссии $\text{SiL}_{2,3}$ аморфных слоев SiN_x переменного состава: 1 – $R = 0$, 2 – $R = 2$, 3 – $R = 4$.

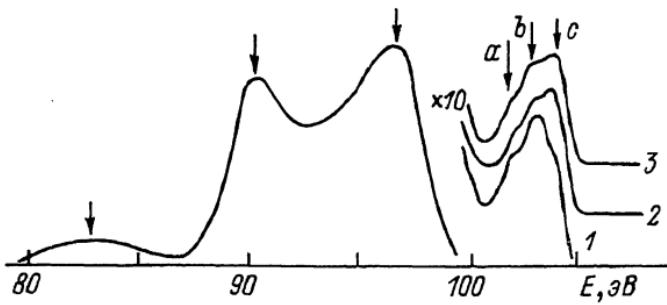


Рис. 2. $\text{SiL}_{2,3}$ -спектры пленок а- Si_3N_4 : 1 – стехиометрического состава, 2 – с избыточным азотом, 3 – имплантированного ионами азота и отожженного.

ных состояний $\text{N}2s-\text{Si}2s$ и $\text{N}2p-\text{Si}3p$ [3], изменяются не более 30%.

Аналогичные изменения спектра ЛС при введении избыточного азота наблюдались нами также для слоев пиролитического а- Si_3N_4 , полученного аммонолизом тетрахлорида кремния при температуре 850 °C. На рис. 2 (кривые 1 и 2) представлены $\text{SiL}_{2,3}$ -спектры эмиссии а- Si_3N_4 стехиометрического состава и с избыточным азотом. Как видно из рисунка, и в этом случае добавление азота в пленку в процессе осаждения сопровождается увеличением интенсивности максимума „с”. К такому же результату приводит имплантация стехиометрического а- Si_3N_4 ионами азота. Слон имплантиро-

вались ионами с энергией 30 кэВ и объемной дозой $5 \cdot 10^{19}$ см⁻³. После имплантации производился импульсный отжиг радиационных дефектов. Кривая З показывает плотность ЛС в имплантированном образце после отжига. На основании полученных данных можно сделать вывод, что интенсивность максимума при энергии 103,2 эВ в слоях SiN_x , близких по составу к стехиометрическому нитриду кремния, коррелирует с содержанием азота в пленке, и что азот при его относительном избытке ответственен за образование локализованных состояний в верхней части шели подвижности.

Таким образом, методом УМРС впервые определены электронная структура ВЗ и особенности спектра ЛС аморфных пленок SiN_x .

В заключение авторы выражают благодарность А.Г. Итальянцеву и В.Н. Мордковичу за проведение имплантации азота в слои а- Si_3N_4 .

Л и т е р а т у р а

- [1] Dunnnett B., Le Comber P.G., Spear W.E. // Phil. Mag. B. 1988, V. 57. N 4. P. 483-492.
- [2] Terekhov V.A., Trostjanskij S.N., Domashewskaia E.P., Golikova O.A. // Phys. Stat. Sol. (B), 1986. V. 138. P. 647-653.
- [3] Брытов И.А., Гриценко В.А., Ромашенко Ю.Н. // ФТТ, 1984. Т. 26. № 6. С. 1685-1690.

Поступило в Редакцию
4 октября 1988 г.

Письма в ЖТФ, том 15, вып. 1

12 января 1989 г.

ВЗАИМОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ОБЪЕМНЫХ И ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛН В СЛОИСТОЙ СТРУКТУРЕ

Д.К. Г р а м о т н е в

В работе [1] было описано взаимное преобразование сдвиговых поверхностных и объемных акустических волн на периодически возмущенной поверхности твердого тела, продемонстрирован резонансный характер такого преобразования. В данной статье на примере сдвиговых волн рассматривается еще один тип взаимного резонансного преобразования поверхностных и объемных акустических волн. Такое преобразование может иметь место в слоистой структуре и аналогично эффекту нарушенного полного внутреннего отражения (НПВО) при возбуждении или обнаружении поверхностных [2] и волноводных [3-5] электромагнитных волн. Получены условия акустического резонанса и подавления зеркального отражения сдвиговой